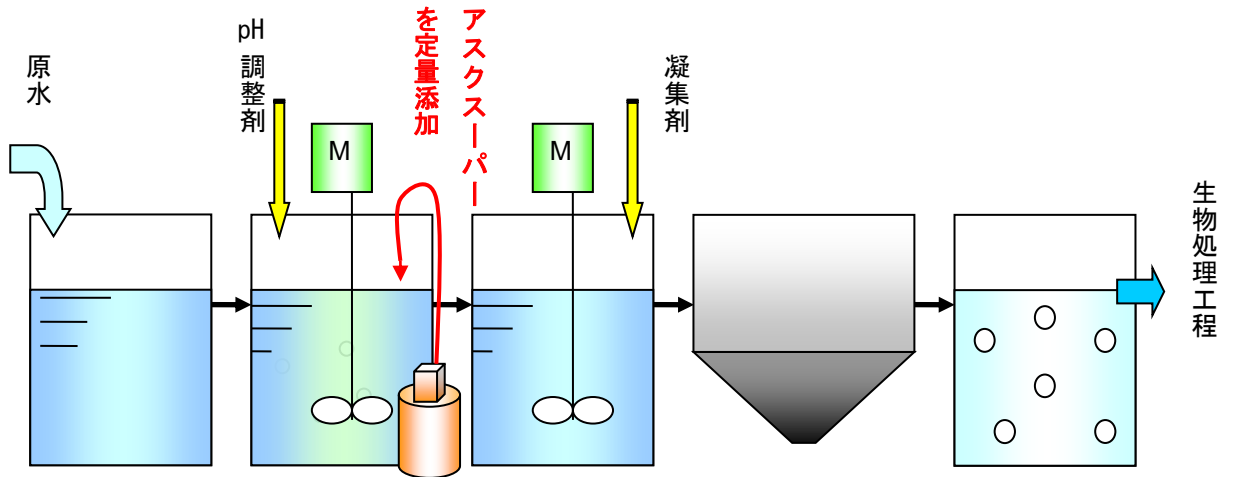


「半導体製造時の過酸化水素を含む廃水」

半導体及び液晶パネル工場の総合排水処理設備での使用例



槽	原水槽	反応槽	凝集槽	沈殿槽	曝気槽
pH	1.0~11.0	6.0~9.0	7.0	7.0	7.0
過酸化水素濃度	1,000ppm	100ppm	30ppm	5ppm 以下	0ppm
滞留時間	15分	15分	15分	180分	30分

アスクスーパーは耐酸・アルカリ性が非常に強く、高濃度過酸化水素でも活性がほとんど低下しないため、半導体工場で行われる基板洗浄、エッチング等の工程で排出される過酸化水素含有廃水の処理に最適です。